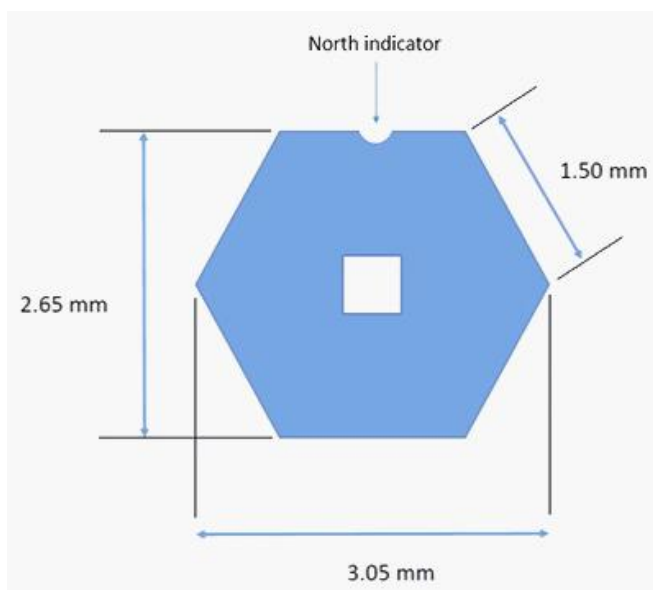


## EM-Tec フレーム付

### シリコンナイトライド(SiN) & メンブラン サポートフィルム

- 20nm SiN サポートフィルム
  - EM-Tec 20nm SiN メンブラン 2 x 1.5x0.1mm ウィンドウ
  - EM-Tec 20nm SiN メンブラン 9 x 0.1x0.1mm ウィンドウ
- 50nm SiN サポートフィルム
  - EM-Tec 50nm SiN メンブラン 0.25x0.25mm ウィンドウ
  - EM-Tec 50nm SiN メンブラン 0.50x0.50mm ウィンドウ
  - EM-Tec 50nm SiN メンブラン 1.0x1.0mm ウィンドウ
  - EM-Tec 50nm SiN メンブラン 1.50x0.5mm ウィンドウ
  - EM-Tec 50nm SiN メンブラン 2 x 1.5x0.1mm ウィンドウ
  - EM-Tec 50nm SiN メンブラン 9 x 0.1x0.1mm ウィンドウ
- 200nm silicon nitride support films
  - EM-Tec 200nm SiN メンブラン 0.25x0.25mm ウィンドウ
  - EM-Tec 200nm SiN メンブラン 0.50x0.50mm ウィンドウ
  - EM-Tec 200nm SiN メンブラン 1.0x1.0mm ウィンドウ
  - EM-Tec 200nm SiN メンブラン 1.50x0.5mm ウィンドウ
  - EM-Tec 200nm SiN メンブラン 2 x 1.5x0.1mm ウィンドウ
  - EM-Tec 200nm SiN メンブラン 9 x 0.1x0.1mm ウィンドウ



六角形アパアパーチャーフレームは  
取扱がし易いように設計された独自の  
シリコンフレームです。

EM-Tec SiN フィルムは工作破片やひずみを抑え、今までの製品に改良を重ね最適化された次世代のシリコン窒化支持膜です。

独自の六角形の頑丈なシリコンフレームにはサンプル/フレーム位置が解る基準マークのフラット微細構造のグリッパエッジを有します。

SiN の特性は、化学品への強い耐性、カーボンフリー、低バックグラウンドで、優れた平坦さを必要とする TEM 支持膜には最適な材質です。ナノ粒子造影、定量炭素分析、支持フィルム上の化学実験、リアルタイムの化学反応と結晶成長研究、薄膜研究の膜細胞の増殖等の広範囲の顕微鏡研究技術のアプリケーションに理想的なサポートフィルムです。

EM-Tec SiN フィルムのウィンドウサイズと膜厚は、独自のアルゴリズムと化学品使用に適した応力の設計が施されています。EM-Tec SiN フィルムは、工作破片を含まない、クリーンかつ高度に平坦な膜を製造するために、最先端の MEMS 技術を用いて製造されます。

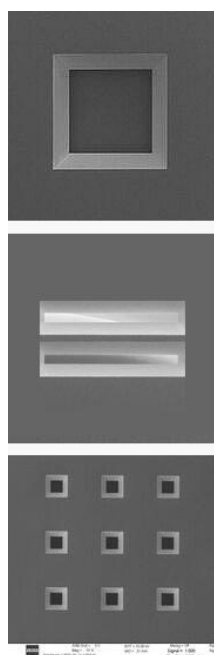
六角形シリコンフレームは取扱いを容易にするために開発されました。

微細構造のグリッパエッジは、円形フレームまたはクリップされた従来のシリコンフレームに比べフレームのピックアップがより容易になりました。

基準マークは、サポートフィルムの複数の手順を行うときの位置調整に役立ちます。六角形フレームは、一辺が 1.5mm で、標準的な 3mm 径の TEM グリッドと互換性があります。

200  $\mu$ m フレームの厚さが最も TEM サンプルホルダに適合します。

製品はグリッドボックスに入れて納品致します。



- アモルファス、低バックグラウンド、低散乱材料
- 酸、塩基および溶媒の高い耐食性
- 耐熱性:1000°C
- カーボンフリー、容易に洗浄
- 支柱バーのない大きな視野面積
- TEM、SEM、FIB、EDX、オージェ、XPS および AFM/ SPM 試料等の理想的なサポート

## EM-Tec SiN フィルムの特徴

- 20、50、200nm 厚の支持フィルムと頑丈な SiN フィルム。
- クリーンで工作破片のないメンブラン
- 強度と高い平坦性への最適化された膜の応力
- 容易な取扱いのユニークな六角形フレーム
- サンプル/フレームの位置確認のための六角形フレームの基準マーク
- フラット、微細構造のグリップエッジ

## SiN サポートフィルム仕様

アパーチャーサイズ		メンブラン厚 / タイプ*		フレーム厚	フレーム形状/直径
0.25 x 0.25mm	-	50nm / LS	200nm / ULS	200 μm	Hex 1.52mm / Ø3.05mm
0.50x0.50mm	-	50nm / ULS	200nm / ULS	200 μm	Hex 1.52mm / Ø3.05mm
1.0 x 1.0mm	-	50nm / ULS	200nm / ULS	200 μm	Hex 1.52mm / Ø3.05mm
1.5 x 0.5mm	-	50nm / ULS	200nm / ULS	200 μm	Hex 1.52mm / Ø3.05mm
2 x 1.5 x 0.1mm	20nm / LS	50nm / LS	200nm / ULS	200 μm	Hex 1.52mm / Ø3.05mm
9 x 0.1 x 0.1mm	20nm / LS	50nm / LS	200nm / ULS	200 μm	Hex 1.52mm / Ø3.05mm

\* ULS = Ultra-Low Stress, LS = Low Stress



備考:本内容は予告なしに変更されることがございます。

〒124-0012 東京都葛飾区立石 3-15-4  
TEL:03-6379-4105 [www.elminet.co.jp](http://www.elminet.co.jp)